

# 年頭所感

特許庁長官 小川 洋



新年あけましておめでとうございます。

小泉総理がその施政方針演説の中で知的財産の重要性に言及された平成14年2月以降、知的財産権を巡る環境は目まぐるしく変化しており、知的財産権に対する世の中の関心はかつてない程高いものとなっております。

政府は、現在、知的財産の創造・保護・活用により国際競争力を強化し、未来を切り開く「知的財産立国」の実現に向け、一丸となって迅速かつダイナミックに取り組んでおります。去る5月に策定された「知的財産推進計画2004」に沿って、関係各府省は取組みを進めているところですが、その特許庁関連の項目数を数えてみますと約127項目にも上ります。知的財産権の制度設計と運用両面を与っている特許庁の責務、期待はますます大きなものとなっているといえるでしょう。特許庁は、その期待に応えるべく、数々の課題に立ち向かっていかねばなりません。

特許審査の迅速化は、権利を早期に確定させ、積極的に研究開発に取り組む企業のトップランナーとしての優位性の確保を可能とします。また、企業の重複研究の回避が可能となり、国内技術開発競争の活性化、研究開発の効率化につながり、国際競争力の向上が期待されます。「知的財産推進計画2004」にも掲げられているとおり、特許審査の順番待ち期間がピークを迎える2008年においても20ヶ月台に留めるとともに、2013年には世界最高水準である11ヶ月を達成するという中長期目標を確実に達成するため、

昨年10月に実施計画を策定しました。審査官の皆さんには、上記目標を達成し、審査順番待ち期間ゼロに向かって的確な審査と更なる審査の効率化に努めて頂きたいと思っております。

また、審査体制を抜本的に強化するため、昨年は98名の任期付審査官を我々の仲間として迎え入れました。本年も昨年に引き続き、各々の道で第一線でご活躍されている方々を任期付審査官として増員いたしますが、皆さんにはその専門性を遺憾なく発揮して頂き、特許審査に新たな息吹を吹き込み、審査の質を更に向上して頂きたいと思えます。

現在は、商品やサービスの質だけではなく、そのデザインやブランドのイメージ等が総体として評価される世の中です。消費者の評価に応じて、企業の意識も変化しているため、制度に関しても常に見直しを行う必要があります。そのため、産業構造審議会に設置された意匠制度、商標制度両委員会での議論を踏まえ、デザインやブランドの保護の在り方について検討を行うこととしています。意匠審査官の皆さんからも審査現場の実態や企業からのニーズを踏まえた積極的な提言を頂けることを期待しております。

経済のグローバル化が進む中で、我が国企業の国際展開を支援するためには、世界各国で安定した特許権等を速やかに取得でき、適切に保護されるような環境を整備することが不可欠です。昨年9月に行われたWIPO一般総会で米国と提出した制度調和に関

する共同提案は、一部の途上国によるアンチパテント思想もあってまとまりませんでした。制度調和に向けては、まず日米欧三極の中で詰められるところは詰めていき、WIPOの場も活用して、途上国のニーズも踏まえながら一步一步前進していくというのが現実的な戦略であると思っております。

他方、模倣品対策に関しては、昨年12月に開催された第9回知的財産戦略本部会合において「模倣品・海賊版対策加速化パッケージ」が取りまとめられたところであり、特許庁としても、同パッケージに沿って、関係省庁・省内関係部局と協力しながら、日中韓特許庁長官会合、FTA/EPA等様々な機会を活用して侵害発生国政府に対する取締り強化を要請するとともに、取締り担当職員を含めた人材の育成等アジア地域のキャパシティビルディングに対する協力を進めます。

「知的財産立国」の実現のためには、国民の理解を得ることも必要です。こうした課題に果敢に取組み、迅速・的確な審査を実現し、知的財産が適切に保護され、有効に活用される環境整備を行うことが、国民の期待に応え、その信頼を獲得していくことにつながっていきます。冒頭でも申し上げましたが、世の中の知的財産権への関心の高まりに比例して、私ども特許庁に対する期待も高まっており、国民の目が常に我々に向けられていることを強く意識しながら日々の業務に専心して頂きたいと思っております。

本年も、一致団結して「知的財産立国」の実現に

向けて日々邁進していきましょう。特許庁技術懇話会のますますの御発展を祈念いたしまして、私からの年頭の挨拶とさせていただきます。

